SULFONATED DIARYLETHENE DERIVATIVE

Patent Number:

JP5301873

Publication date:

1993-11-16

Inventor(s):

KABASAWA MAKOTO; others: 04

Applicant(s)::

KANEBO LTD

Requested Patent:

☐ JP5301873

Application Number: JP19920131531 19920423

Priority Number(s):

IPC Classification: C07D409/10; C09K9/02; G03C1/73

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To provide a new compound excellent in thermal stability, moisture resistance, sensitivity, and durability, useful for e.g. optical recording materials.

CONSTITUTION: The objective compound of formula I (n is 2-5; R<1> is alkyl; R<2>-R<5> are each H. alkyl, alkoxy or dialkylamino), e.g. 1-(6-cyano-2-methyl-3- benzothienyl-2-(1,2-dimethyl-5methyoxy-3-indolyl)-3,3,4,4,5,5- hexafluorocyclopentene. The compound of the formula I can be obtained by simultaneous reaction between a cycloperfluorocycloalkene compound of formula II, a 6cyano-1,1-dioxobenzothienyllithium derivative of formula III and an indolyllithium derivative of formula IV.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平5-301873

(43)公開日 平成5年(1993)11月16日

| (51)Int.Cl. ⁶ | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI | 技術表示箇所 |
|--------------------------|--------|---------|----|--------|
| C 0 7 D 409/ | 10 209 | 8829-4C | | |
| C09K 9/ | 02 B | 6917-4H | | |
| G 0 3 C 1/ | 73 503 | 8910-2H | | |

審査請求 未請求 請求項の数1(全 10 頁)

| (21)出願番号 | 特願平4-131531 | (71)出願人 | 000000952 |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------------|
| | | | 鐘紡株式会社 |
| (22)出願日 | 平成 4年(1992) 4月23日 | 1 | 東京都墨田区墨田五丁目17番 4号 |
| | | (72)発明者 | 椛澤 誠 |
| 特許法第30条第1項適用申請有り 平成4年3月16日 | | | 大阪府吹田市山田西4丁目4番14-1112号 |
| 社団法人日本化学会発行の「日本化学会第63春季年会講 | | (72)発明者 | 石川 篤 |
| 演予稿集【【】」に発表 | | | 大阪市西淀川区佃5丁目12番5-805号 |
| | | (72)発明者 | 堀川 幸雄 |
| | | | 大阪府松原市柴垣1丁目27番12号 |
| | | (72)発明者 | 藤野 秦光 |
| | | | 大阪市都島区友渕町1丁目6番1-305号 |
| | | (72)発明者 | 入江 正浩 |
| | | | 福岡県春日市春日公園 1 丁目29番地 |
| | | | |

(54) 【発明の名称】 スルフォン化ジアリールエテン誘導体

(57)【要約】

【構成】 下記一般式

【化1】

(ただし式中 n は $2\sim5$ の整数を表わす。 R^1 はアルキル基、 $R^2\sim R^5$ は水素原子,アルキル基,アルコキシ基又はジアルキルアミノ基を表す。)にて示されるスルフォン化ジアリールエテン誘導体。

【効果】 以上のように、本発明のスルフォン化ジアリ

R1 ールエテン誘導体は、熱安定性、耐湿性、感度に優れ、 かつ着消色の繰り返し耐久性の良好なフォトクロミック 性を有し、これを用いれば性能の優れた可逆的光記録材 料などを得ることができる。 【請求項1】 下記一般式

【化1】

(ただし、nは2~5の整数を表わす。 R^1 はアルキル基、 R^2 ~ R^5 は水素原子,アルキル基,アルコキシ基又はジアルキルアミノ基を表す。)にて示されるスルフォン化ジアリールエテン誘導体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なスルフォン化ジアリールエテン誘導体に係り、更に詳細には、フォトクロミック性を有し、光記録材料等に好適なスルフォン化ジアリールエテン誘導体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、記録, 記憶材料, 複写材料, 調光材料, 印刷感光体, レーザー用感光体, マスキング材料, 光量計あるいは表示材料に利用される光照射により可逆的に色相変化する種々のフォトクロミック性を有する化合物が提案されている。例えば、それらのフォトクロミック化合物としてベンゾスピロピラン類, ナフトオキサジン類, フルギド類, ジアゾ化合物あるいはジアリールエテン類等の化合物が提案されている。

【0003】そして、このようなフォトクロミック化合物を可逆的な光記録材料に応用するためには特に次のような性能が要求される。すなわち、(1)記録の安定性,(2)繰り返し耐久性,(3)高い感度,(4)半

導体レーザー感受性等である。ところが、前記既存のフォトクロミック化合物は、一般に着色状態又は消色状態 のどちらか一方が熱的に不安定であり、室温においても 数時間以内により安定な状態に戻るため、記録の安定性が確保できないという欠点を有している。又、光照射による二つの状態が熱的には比較的安定なものとして、フルギド類やジアリールエテン類が知られているが、記録 材料に応用するには水分や酸素に対する安定性が十分でなかったり、あるいは、感度が不足しているといった欠点があり、未だ光記録材料として十分満足な性能を有するフォトクロミック化合物がないのが現状である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情に鑑み、なされたものであって、その目的とするところは、記録が熱、酸素、水分等に対して安定で、繰り返し耐久性がよく、分子吸光係数の大きいフォトクロミック材料として優れた特性を有するスルフォン化ジアリールエテン誘導体を提供するにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上述の目的は、下記一般 式

[化2]

(ただし、nは2~5の整数を表わす。 R^1 はアルキル 基、 R^2 ~ R^5 は水素原子,アルキル基,アルコキシ基 又はジアルキルアミノ基を表す。)にて示されるスルフォン化ジアリールエテン誘導体によって達成される。

【0006】次に本発明を詳しく説明する。本発明のスルフォン化ジアリールエテン誘導体は、前配化2で表わされるものであり、nは2~5の整数で、二重結合と共同して、4~7員環の環状構造を有する。中でもnが3又は4の5又は6員環が特に好ましいフォトクロミック

【0007】また、R¹ はアルキル基を表し、R² ~R は水素原子、アルキル基、アルコキシ基又はジアルキルアミノ基を表す。電子供与性のインドリル基と電子吸引性の6ーシアノー1、1ージオキソベンゾチエニル基との相互作用で、吸収波長の長波長化、記録の熱安定性、高い繰り返し耐久性及び高い分子吸光係数が達成される。

【〇〇〇8】本発明のスルフォン化ジアリールエテン誘

導体は、種々の方法により製造可能であるが、例えば、 次のような方法で製造される。即ち、

【化3】

$$\begin{pmatrix} (CF_2) & n \\ C & C \end{pmatrix}$$

(ただし、nは前配に同じ。)で示されるシクロパーフルオロシクロアルケン化合物と、

【化4】

で示される6-シアノ-1, 1-ジオキソベンゾチェニルリチウム誘導体と、

【化5】

NC S CH;

(ただし、n, R¹ ~ R⁵ は前記に同じ。)で示される スルフォン化していない6 - シアノーベンゾチエニル基 を有するジアリールエテン誘導体を合成し、酸化剤によ り、6 - シアノーベンゾチエニル基の硫黄原子をスルフ ォン化する方法、あるいは

【化8】

(ただし、nは前記に同じ。)で示される同様にスルフォン化していない6-シアノーベンゾチエニル基を有するモノアリールエテン誘導体を合成し、酸化剤によりスルフォン化した後、前述の化5で示されるインドリルリ

(ただし、 R^1 $\sim R^5$ は前記に同じ。)で示されるインドリルリチウム誘導体とを同時に反応させる方法、化 4 のみを反応させて一つの 6 - シアノー 1 + 1 + ジオキソベンゾチエニル基が導入された

【化6】

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
(C F_2) & n \\
C & C \\
\hline
C & F
\end{pmatrix}$$

(ただし、nは前記に両じ。)で示されるモノアリール エテン誘導体とし、次にもう一方のインドリルリチウム 誘導体(化5)を前述のモノアリールエテン誘導体(化 6)と反応させる方法、

【化7】

CH₃ N R⁵ R⁴ チウム誘導体と反応させる方法などが

チウム誘導体と反応させる方法などが挙げられるが、反応操作の簡便性と収率の上から後2者のモノアリールエテン誘導体又はジアリールエテン誘導体をスルフォン化する方法が好ましい。

R³

【0009】好適な製造方法の一例を挙げると次の通りである。即ち、まず、

【化9】

NC S CH

(ただし、Xは奥索原子又はヨウ素原子を表す。)で示される6-シアノーベンゾチエニルハライド誘導体をアルキルリチウムまたはリチウムジアルキルアミドと反応させ、ハロゲンをリチウムに置換した6-シアノベンゾ

チエニルリチウム誘導体とする。

【0010】溶媒としてはテトラヒドロフランやジェチルエーテル等のエーテル系溶媒が好ましく用いられ、更に低温での溶媒凝固を防ぐためにnーへキサン、nーペンタン等の低級アルカンを混合してもよい。リチオ化剤のアルキルリチウム、リチウムジアルキルアミドとしてルリチウム、リチウムジアループチルリチウム、リチウムジアループチルリチウム、リチウムジアルーが等が挙げられるが、nーブチルリチウムのヘキサン溶液が好適に用いられる。リチオ化剤の量は、6ーシアノベンゾチにルハライド誘導体の総量に対して1、0~1、2倍モル使用するのが好ましい。反応温度は、一45~一120℃で、好ましくは-70~一110℃の低温で行う。反応時間は通常20分~3時間で、好ましくは30分~2時間である。

【0011】次に、生成した6ーシアノベンゾチエニルリチウム誘導体に、化3で示されるパーフルオロシクロアルケン化合物を添加するが、使用するパーフルオロシクロアルケン化合物の量は、6ーシアノベンゾチエニルハライド誘導体の1.0~1.5倍モル用いるのが好ましく、希釈せずに、あるいは溶媒に希釈して添加することができる。通常、この反応温度は一60~110℃で、反応時間は30分~5時間である。反応終了後、すぐに水またはアルコール等を加えて反応を完了させても、また室温まで液温をもどしてから反応を完了させてもよいが低温のうちに反応を完了させた方が収率がよい。かくして、化8で示されるモノー6ーシアノベンゾチエニルエテン誘導体が得られる。

【0012】次に、ジアリールエテン誘導体を得るためには、

【化10】

$$\begin{array}{c|c}
Y & R^2 \\
C H_3 & N & R^5 \\
R^1 & R^5
\end{array}$$

(ただし、Yは臭素原子またはヨウ素原子を表し、R¹ ~R⁵ は前記に同じ。)で示されるインドリルハライド誘導体を前記と同じ方法でインドリルリチウム誘導体とし、これに前述のモノー6ーシアノベンゾチエニルエテン誘導体のテトラヒドロフラン溶液を添加する。使用するモノー6ーシアノベンゾチエニルエテン誘導体の量は、インドリルハライド誘導体の1.0~1.2倍モル用いるのが好ましい。通常、この反応温度は一60~110℃で、反応時間は30分~5時間である。反応終了後、すぐに水またはアルコール等を加えて反応を完了させても、また室温まで液温をもどしてから反応を完了

させてもよいが、低温のうちに反応を完結させた方が収 率がよい。

【0013】製造方法としては、上記のように化8で示されるモノアリールエテン誘導体と化10で示されるインドリルハライド誘導体を反応させる方法とは逆に、まず、化3で示されるパーフルオロシクロアルケン化合物と化10で示されるインドリルハライド誘導体から、【化11】

(ただし、n, R¹ ~ R³ は前記に同じ。)で示される モノインドリルエテン誘導体を合成した後に、前記化9 で示される6 - シアノベンゾチエニルハライド誘導体と 反応させてもよい。リチオ化反応、モノアリールエテン 合成、ジアリールエテン合成ともに前述の製造方法と同様な条件下で行うことができる。

【0014】また、他の製造方法として、前配化10で 示されるインドリルハライド誘導体と、前記化9で示さ れる6-シアノベンゾチエニルハライド誘導体とを同時 に反応させることも可能である。すなわち、前配化9で 示される6-シアノベンゾチエニルハライド誘導体と前 記化10で示されるインドリルハライド誘導体の等モル 量混合物を、リチオ化剤の量を6-シアノベンゾチエニ ルハライド誘導体とインドリルハライド誘導体の総量の 1.0~1.2倍モル使用すること以外は前述の製造方 法と同様な条件下でリチオ化反応を行う。続いて、やは り前述の製造方法と同様な条件下で前記化3で示される パーフルオロシクロアルケン化合物を添加することによ って得ることができる。前2者の逐次反応では、2種類 のアリール基が導入されたジアリールエテン化合物を選 択的に得る利点を有し、一方、最後の同時反応では1ポ ット2段階反応の簡便さが特長である。かくして化フで 示されるスルフォン化ジアリールエテン誘導体が得られ る。

【0015】得られた化7又は化8で示されるジアリールエテン誘導体あるいはモノアリールエテン誘導体をスルフォン化する方法としては、過酸化水素、過酢酸、トリフルオロ過酢酸、過安息香酸、m-クロロ過安息香酸、ジメチルジオキシラン、ヒーブチルヒドロペルオキシドオキソン(Oxone Du.pont社製)、過マンガン酸カリウム等の酸化剤と反応させ、硫黄原子をスルフォン化する方法などが挙げられるが、好ましくはm-クロロ過安息香酸、ジメチルジオキシランが好適に用いられる。過酸化物の量は、硫黄原子の総量に対して

2. $0\sim5$. 0倍当量用いるのが好ましい。溶媒としては、ジクロロメタン、1, 2-ジクロロエタン等の塩素系溶媒が好ましく用いられる。反応温度は-70 ~5 0 \sim で、好ましくは-20 ~30 \sim で行う。反応時間は、1時間 ~72 時間、好ましくは4時間 ~24 時間である。

【0016】以上の方法で得られた反応物からジアリー ルエテン化合物を得るには、抽出,カラムクロマトグラフ,再結晶法等の方法を用いて分離,精製すればよい。 本発明のジアリールエテン化合物は、その一例として、 1-(6-シアノ-2-メチル-1, 1-ジオキソ-3 ーペンゾチエニル)-2-(1, 2-ジメチル-5-メトキシ-3-インドリル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの例について説明する と、下記式のように紫外光により閉環体に変化して緑色になる。

【化12】

紫外光~450nmの光

可視光

【化13】

【0017】また、この閉環体に可視光を照射すると、元の開環体に戻り、消色する。本発明のジアリールエテン化合物は、着色状態も消色状態も熱安定性が高く、又水分に対しても安定で、長期間変化せず、良好に保持される。また、着消色の繰り返し耐久性にも優れ、着色状態の吸収が670nm以上となるので670nm或いは、780nmの発振波長を有する半導体レーザーを使用することができ、又記録の感度に影響する閉環体の分子吸光係数も大きくなるので、光記録材料に好適に用いることができる。

【〇〇18】本発明の新規ジアリールエテン化合物を含有する記録層を利用した光記録材料は、公知の方法で容易に得ることができる。例えば、本発明のジアリールエテン化合物を、公知の蒸着法により適当な基板上に蒸着する方法、本発明のジアリールエテン化合物を、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、

プロ 313 ポリビニルブチラール樹脂, ポリメチルメタクリル酸樹脂, ポリカーボネイト樹脂, フェノール樹脂, エポキシ樹脂等の樹脂パインダーと共に、ベンゼン, トルエン, ヘキサン, シクロヘキサン, メチルエチルケトン, アセトン, メタノール, エタノール, エタノール, テトラハイドロフラン, ジオキサン, 四塩化炭素, クロロホルム等の溶媒に分散又は溶解させて、適当な基板上に塗布する方法、本発明のジアリールエテン化合物を方記のような溶媒に溶解し、ガラスセル等に封入する方法などにより、記録層を形成し、光記録材料とすることができる。

[0019]

【発明の効果】以上のように、本発明のジアリールエテン化合物は、熱安定性、耐湿性、感度に優れ、かつ着消色の繰り返し耐久性の良好なフォトクロミック性を有し、これを用いれば性能の優れた可逆的光記録材料など

を得ることができる。以下に、実施例を挙げて本発明を 具体的に説明する。

【0020】(実施例1)

(1) 1 - (6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチエニル) -2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロシクロペンテンの製造

300mlの3つロフラスコ中で、3-ブロモー6-シア ノー2ーメチルベンゾチオフェン5. Og (20mmol) をテトラハイドロフラン100mlとn-ヘキサン10ml に溶解し、窒素気流下、-100℃で、1. 6規定のn ープチルリチウムヘキサン溶液12.5mlを30分間か けて滴下し、2時間攪拌した。次に、パーフルオロシク ロペンテン4. 3g(20mmol)のテトラハイドロフラ ン溶液20mlを30分間かけて滴下した。3時間反応さ せ、メタノールを滴下して反応を終結させ、水洗し、ジ エチルエーテルで3回抽出した。有機層を集め、乾燥後 ジエチルエーテルを留去した。反応生成物をシリカゲル のカラムクロマトグラフを用い、分離、精製した結果、 下記化14の構造の1-(6-シアノ-2-メチル-3 ーペンゾチエニル) -2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘ プタフルオロシクロペンテンを4.5g(収率62%) を黄白色沈殿として得た。

[0021] [化14]

$$CF_{2}$$

$$CF_{2}$$

$$CF_{2}$$

$$CF_{3}$$

$$CF_{4}$$

分析值:

(1) 1H-NMR (CDC 1,) 8 (ppm) 2. 57 (s, 3H) 7. 59 (s, 2H) 8. 15 (s, 1H)

(II) MS (m/e) 365 (M°)

(III) IR (cm⁻¹) 2205

【0022】(2) 1-(6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(1, 2-ジメチル-5-メトキシ-3-インドリル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

200mlの3つロフラスコ中で、3-ブロモー1、2-ジメチルインドール1. 2g (5mmol)をテトラハイド ロフラン50mlとn-ヘキサン5mlに溶解し、窒素気流 下-78℃で、1.6規定のn-ブチルリチウムヘキサ ン溶液3. 2mlを30分間かけて滴下し、1時間攪拌し た。次に、実施例1-(1)で合成した1-(6-シア ノー2-メチルー3-ベンゾチエニル)-2.3.3. 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロシクロペンテン1. 8 3g(5mmol)のテトラハイドロフラン溶液5mlを、-90℃で30分間かけて滴下した。3時間反応させ、メ タノールを滴下して反応を終結させ、水洗し、ジエチル エーテルで3回抽出した。ジエチルエーテル層を集め乾 燥後、ジエチルエーテルを留去した。反応生成物をシリ カゲルのカラムクロマトグラフを用い、分離、精製した 結果、下記化15の構造の1-(6-シアノー2-メチ ルー3ーペンゾチエニル)-2-(1, 2ージメチルー 5-メトキシ-3-インドリル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンを2g(収率7 7%)を黄白色結晶として得た。

[0023] 【化15】

CF₂ CF₂

C=C

C=C

OCH₃

NC

分析値:

(I) 1 H-NMR (CDCI,)

δ (ppm) 1. 94 (s, 1 H) 2. 30 (s, 1 H) 3. 51 (s, 1 H) 3. 71 (s, 1 H) 6. 81~8. 00 (m, 2 H)

(II) MS (m/e) 520 (M)

(III) IR (cm⁻¹) 2227 (ν_{QI})

[0024] (3) 1-(6-シアノ-2-メチルー

113 1, 1-ジオキソー3-ベンゾチエニル) -2-(1, 2-ジメチル-5-メトキシ-3-インドリル) -3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロベンテンの 製造

1000mlの2つロフラスコ中で、実施例1-(2)で 合成した1-(6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチ エニル)-2-(1,2-ジメチル-5-メトキシ-3 -インドリル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフル オロシクロペンテン5.2g(10mmol)をジクロロメタン500mlに溶かし、氷冷下で70%メタクロロ過ちを放7.4g(30mmol)のジクロロメタン溶液100mlを滴下し、室温まで戻し、12時間攪拌した。反応後、溶液を亜硫酸水素ナトリウム飽和水溶液、炭酸水水溶液、1規定の水酸化ナトリウム水溶液、1規定の水酸化ナトリウム水溶液、1規定の水酸化サトリウム水溶液、1規定の水酸化サトリウム水溶液、1規定の水酸化サトリウム水溶液、1規定の水酸化サトリウム水多次で洗浄した後、有機層を集め、乾燥後ジクロロメタリーを留去した結果、前配化12の構造の1-(6-シアール)-2-(1,2-ジメチル-5-メトキシー3-イル・フェー(1,2-ジメチル-5-メトキシー3-イル・フェー(1,2-ジメチル-5-メトキシー3-イル・フェー(1,2-ジメチル-5-メトキシー3-イル・フェー(1,6-5g(収率30%)を橙色固体として得た。

[0025] (化12)

分析值:

(I) $^{1}H-NMR$ (CDCI₃)

δ (ppm) 2. 06 (s, 1H) 2. 17, 2. 22 (s, s, 1H) 3. 66 (s, 1H) 6. 70 ~7. 91 (m, 2H)

(II) MS (m/e) 552 (M[†])

(III) IR (cm⁻¹) 1315 (ν so₂) 2232 (ν _{ON})

【0026】(4)フォトクロミック性

上記で合成した化合物をベンゼンに10⁴ モル/ Iになるように溶解して得た溶液を $1 \times 1 \times 4$ c mの石英ガラスセルに入れ、これに405 n mの干渉フィルター(日本真空光学社製)を装着した100 W超高圧水銀灯(オスラム社製)により405 n mの光を30 秒間照射したところ、緑色に着色した。吸収スペクトルは図1 に実線で示すものから679 n mに極大吸収を持つ、点線で示すものに変化した。次に、緑色に着色した溶液に、カットフィルター(日本真空光学社製)を装着した100 の超高圧水銀灯により500 n m以上の可視光を30 秒間照射したところ、ただちに消色し、元の黄色の状態に変化した。この変化は可逆的に繰り返すことができた。着色体の679 n mにおける分子吸光係数は、ベンゼン中で14000 と高いものであった。

【0027】(5)繰り返し耐久性(可逆的着色消色サイクル耐性)

上記(4)で作成したベンゼン溶液に、401 nmの干渉フィルター(日本真空光学社製)を装着した100Wの超高圧水銀灯(オスラム社製)により405 nmの光を200秒間照射し、光定常状態まで着色した。次に、この着色状態の溶液に500 nm以下カットフィルター(日本真空光学社製)を装着した100Wの超高圧水銀

灯により500nm以上の黄色光を60秒間照射したところ消色した。この2種類の光の交互照射により着色消色を1サイクルとして、繰り返し耐久性試験を行った。この結果を図2に示す。尚、図2中、A。/A。のA。は、初期の着色状態の679nmの吸光度である。図2に示すように、1500回繰り返した時点でも着色状態の679nmの吸光度は初期の値と同じ値を保持し、優れた繰り返し耐久性を有していた。

【0028】(6)保存安定性

実施例1-(3)で合成した化合物をトルエンに10⁻¹ モル/ Iになるように得た溶液を1×1×4cmの石英ガラス製の密閉容器に入れ、405nmの光により光定常状態になるまで着色し、遮光し、温度80℃の恒温槽に入れ、吸光度の変化を観察した。その結果を図3に示す。尚、図3中、A/A。のA。は、初期の679nmの吸光度、Aは、保存した後の吸光度を示す。その結果、90日間経過しても吸光度の変化はほとんどなく、記録を安定に保存することができた。

【0029】(実施例2)

(1) 1-(6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(1, 2-ジメチル-3-インドリル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造

200mlの3つロフラスコ中で、3ープロモー1,2ージメチルインドール1.2g(5mmol)をテトラハイドロフラン50mlとn-n+yン5mlに溶解し、窒素気流下-78 $^{\circ}$ で、1.6規定のn-7チルリチウムn+yン3.2mlを、90 $^{\circ}$ で30分間かけて滴下し、1時間 攪拌した。

【0030】次に、実施例1-(1)で合成した1-(6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2、3、3、4、4、5、5-ヘプタフルオロシクロペンテン1.83g(5mmol)のテトラハイドロフラン溶液5mlを、-90℃で30分間かけて滴下した。3時間反応させ、メタノールを滴下して反応を終結させ、水洗し、ジエチルエーテルで3回抽出した。ジエチルエーテル層を集め乾燥後、ジエチルエーテルを留去した。反応生成物をシリカゲルのカラムクロマトグラフを用い、分離、精製した結果、下記化16の構造の1-(6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(1、2ージメチル-3-インドリル)-3、3、4、4、5、5ーへキサフルオロシクロペンテン2.0g(収率80%)を黄白色結晶として得た。

[0031]

【化16】

分析值:

(I) 1H-NMR (CDCI3)

δ (ppm) 1. 97 (s, 3H) 2. 35 (s, 3H) 4. 35 (s, 3H) 7. 10~8. 23 (m, 7H)

(II) MS (m/e) 490 (M)

(III) IR (cm $^{-1}$) 2205 (ν_{CH})

【0032】(2) 1-(6-シアノ-2-メチル-1, 1-ジオキソ-3-ベンゾチエニル)-2-(1, 2-ジメチル-3-インドリル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテンの製造500mlの2つロフラスコ中で、実施例2-(1)で合成した1-(6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチエ

成した1-(6-シアノ-2-メチル-3-ベンゾチエニル)-2-(1, 2-ジメチル-3-インドリル)-3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘキサフルオロシクロペンテ

ン4.9g(10mmol)のジクロロメタン100mlに溶解し、氷冷下で70%メタクロロ過安息香酸7.4g(30mmol)のジクロロメタン溶液100mlを滴下し、室温まで戻し、12時間攪拌した。反応後、析出した沈殿をろ別し、ろ液を亜硫酸水素ナトリウム飽和水溶液、炭酸水素ナトリウム飽和水溶液で洗浄した後、有機層を集め、乾燥後、ジクロロメタンを留去した。反応生成物をヘキサンにより再結晶した結果、下記化17の構造の1-(6-シアノ-2-メチル-1,1-ジオキソ-3-インゾチエニル)-2-(1,2-ジメチル-3-インドリル)-3,3,4,4,5,5-ヘキサフルオロシクロペンテン3.6g(収率69%)を黄色結晶として得た。

[0033] 【化17】

分析值

(I) H-NMR (CDCI3)

δ (ppm) 2. 10 (s, 3H) 2. 24 (s, 3H) 3. 60 (s, 3H) 7. 14~7. 90 (m, 7H)

(II) MS (m/e) 522 (M)

(III) IR (cm⁻¹) 1314 (ν so₂) 2232 (ν _{ON})

【0034】(3)フォトクロミック性

実施例1と同様にして、ベンゼンに10⁻⁴ モル/ I になるように溶解して得た溶液を1×1×4cmの石英ガラスセルに入れ、これに405nmの干渉フィルター(日本真空光学社製)により405nmの光を120秒間照射したところ、緑色に着色した。吸収スペクトルは、図4の実線で示すものから、625nmに極大吸収を持つ

点線で示すもので変化した。次に、緑色に着色した溶液にカットフィルター(日本真空光学社製)を装着した100Wの超高圧水銀灯により500nm以上の黄色光を60秒間照射したところ、ただちに消色し、元の黄色の状態に変化した。この変化は可逆的に繰り返すことができた。着色体の625nmにおける分子吸光係数は、ベンゼン中で13000と高いものであった。

【0035】(4)繰り返し耐久性(可逆的着色消色サイクル耐性)

実施例2-(2)で合成した化合物の10mgをポリスチレン100mgとともにトルエン1mlに溶解し、これを1×3cm角に石英ガラス板上にスピンコーティング法により塗布、乾燥して記録層を作製した。この記録層の吸収スペクトルの625nmにおける吸光度は0.033であった。この記録層に、401nmの干渉フィル

ター(日本真空光学社製)を装着した100Wの超高圧水銀灯(オスラム社製)により405nmの光を120秒間照射し、全面着色状態にした。得られた着色状態の吸収スペクトルの625nmにおける吸光度は0.276であった。次に、この着色状態の記録層に500nm以下カットフィルター(日本真空光学社製)を装着した100Wの超高圧水銀灯により500nm以上の黄色収入でクトルの吸光度は0.034に戻った。この2種類の光の交互照射により着色消色を1サイクルとして、繰り返し耐久性試験を行った。この結果を図5に示す。図5に示すように、1500回繰り返した時点での625nmの吸光度は消色状態で0.035、着色状態で0.275と優れた繰り返し耐久性を有していた。

【0036】(5)保存安定性

上記(4)で繰り返し耐久性で使用したものと同様にして作製した記録層の2枚のうち、一方を紫外光により着色し、他方を未着色のまま、アルミホイルで遮光し、温度80℃、湿度65%RHの恒温恒湿度槽に入れ、吸光

度の変化を観察した。その結果を図6に示す。その結果、90日間経過しても吸光度の変化はほとんどなく、記録を安定に保存することができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1-(3)で合成した化合物のペンゼン 溶液中の吸収スペクトルの光変化を示す線図。

【図2】 実施例1 で調製したベンゼン溶液の405 nm の光及び500 nm以上の黄色光の交互照射にともなう679 nmにおける吸光度の変化を示した線図。

【図3】実施例1で調製したトルエン溶液の着色状態の 80℃における経日変化を示した図。

【図4】実施例2-(2)で合成した化合物のペンゼン 溶液中の吸収スペクトルの光変化を示す線図。

【図5】実施例2で作製した光記録層の405nmの光及び500nm以上の黄色光の交互照射にともなう625nmにおける吸光度の変化を示した線図。

【図6】実施例2で作製した光記録の着色及び消色状態の80℃における経日変化を示した図。



